

CCMicro		29 octobre 2021	
Appareil	Spécificités	Lieux	Responsables
FEI Quanta450	Source W, pression contrôlée et mode environnemental (< 2600 Pa), EDS Quantax Bruker SDD 30mm ²	ENSIACET	D. Oquab, Y. Thebault
MEB JEOL JSM6510LV	Source W, EDS Bruker 50mm ²	UPS Chimie 2R1 Salle 1087 B	Y. Borjon-Piron
MEB TESCAN VEGA3	Source W, EDS Oxford X-Max 50mm ²	UPS Chimie Salle 17	Y. Borjon-Piron
Métalliseur Quorum Q150R ES Plus	Métallisation Au, Au/Pd, Ag, C, Pt à mouvement planétaire. Mesure des épaisseurs par balance quartz	UPS Chimie Salle 17	Y. Borjon-Piron
Pulvérisateur cathodique Edward S150B	Métallisation Ag	UPS Chimie Salle 17	Y. Borjon-Piron
Pulvérisateur cathodique JEOL JFC1200	Métallisation Ag	UPS Chimie 2R1 Salle 1087 B	Y. Borjon-Piron
Pulvérisateur cathodique Cressington	Métallisation Ag, Au, Pt. Mesure des épaisseurs par quartz.	UPS Chimie Salle 15	M.-C. Barthelemy
D'autres équipements sont accessibles au Centre de Microcaractérisation Raimond Castaing (UAR 3623) https://ccarcastaing.cnrs.fr/spip.php?rubrique3			